

分析結果報告書

2006年 7月14日
分析No 06706-2

貴社名 株式会社

工場名 前橋精機プラント 液量 約5000 L (株)アメロイド日本サービス社

機械名 高周波焼入れ設備 IH-1、2 流量 10 L/min 分析センター

試料名 高周波焼入れ液 フィルタ名 WF2K(デモ機)

銘柄 設置日 2006年6月8日



試験項目	採取月日	④ 6 / 30 (23 : 50)	⑤ 6 / 30 (10 : 00)	試験方法
	採取個所	WF2K入口	W2K出口	
備考		≡タンク内		
汚染度	mg/100ml	22	1.7	JIS B 9931
粒径分布 個/100ml	5~15 μm	496,283 (11)	157,411 (10)	JIS B 9930
	15~25 μm	30,608 (10)	2,186 (6)	
	25~50 μm	4,190 (10)	0 (0)	
	50~100 μm	1,391 (10)	0 (0)	
	100 μm以上	1,192 (外)	0 (0)	
油分	mg/l	102.0	61.4	
pH				JIS Z 8802
動粘度	40°C mm ² /S			JIS K 2283
全酸価	mgKOH/g			JIS K 2501

▼粒径分布 HIAC/ROYCO自動粒子計測器システムNo.8011 [粒径分布の()内数字はNAS等級。]

微粒子画像処理システム計測法

▼ろ過フィルタ

0.8 μm

5 μm

▼ろ過量

100ml

10ml

▼写真倍率

: ×50

所見:

この所見は、一定の方法で採取された試料と正しい試料情報を前提とした参考所見であり、御社の活動を制約するものではありません。

